PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

AK

(11)Publication number:

61-246219

(43) Date of publication of application: 01.11.1986

(51)Int.Cl.

CO8G 8/28 CO8G 59/08 HO1L 23/30

(21)Application number: 60-087698

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

24.04.1985

(72)Inventor: TOYOSHIMA YOSHIKI

TAKAHASHI TSUTOMU

SAITO NORIAKI

(54) POLYPHENOL NOVOLAK GLYCIDYL ETHER, ITS PRODUCTION AND USE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled ether which is low in a hydrolyzable chlorine content and can give a cured product of excellent heat resistance, by condensing a specified bisphenol with an aldehyde and converting the obtained polyphenol into a glycidyl ether by reaction with an epihalohydrin.

CONSTITUTION: A polyphenol is prepared by polycondensing a bisphenol (1,3,3- trimethyl-1-p-hydroxyphenylindan-6-ol) of formula I with an aldehyde of the formula: RCHO. This polyphenol is converted into a polyphenol novolak glycidyl ether of formula II by etherification with an epihalohydrin. In the formulae, R is H, a 1W4 C alkyl or an aromatic group and 1.5≤n≤25. The obtained compound of formula II is mixed with various additives and can be used as a sealing agent for, especially, semiconductor integrated circuits.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-246219

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)11月1日

C 08 G 8/28 59/08 H 01 L 23/30 101

2102-4 J 6946-4 J

R-6835-5F 審査請求 未請求 発明の数 3 (全7頁)

❷発明の名称

多価フェノールノボラツクのグリシジルエーテル、その製造方法及 び用途

②特 願 昭60-87698

@出 願 昭60(1985)4月24日

砂発明 者

芳 樹

新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内

郊発 明 者

高 橋

敷鄋

新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内

の発明者 斉藤 憲 U

新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内 大阪市東区北浜5丁目15番地

⑪出 願 人 住友化学工業株式会社⑫代 理 人 弁理士 諸石 光潔

外1名

1. 発明の名称

多価フェノールノポラックのグリシジルエー テル、その製造方法及び用途

- 2. 特許欝求の範囲
 - (1) 一般式

(式中、Rは水紫原子、炭素数1~4のアルキル基及び芳香炭基からなる群より選ばれた基であり、nは平均1.5以上25以下の数である。)

で表わされる多価フェノールノポラックのグ リシジルエーテル。

(2) 式

で表わされるピスフェノール(1,8,8ート リメチルー1, pーヒドロキシフェニルーイ ンダンー6ーオール)を、一般式

R C H O (m

(式中、 R の定義は、 上配一般式(I) のそれ と同じである。)

で表わされるアルデヒド類と縮重合して多価フェノールとし、ついで該多価フェノールを エピハロヒドリンでもってグリシジルエーテ ル化することを特徴とする多価フェノールの グリシジルエーテルの製造方法。

(8) 上記一般式(1)で表わされる多価フェノール ノボラックのグリシジルエーテルからなる半 導体集積回路對止剤。

特開昭61-246219(2)

8. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は特定のエポキシ樹脂に関する。 従来の技術

半導体集積回路封止用の樹脂材料には、半導体集積回路を外部環境から保護するために、様々な厳しい物性が要求されている。

封止用の樹脂としては、耐湿性、加工性、電気 特性及び価格の面から、エポキシ樹脂が主流と なっている。その中でもフェノールノポラック 及びクレゾールノポラックのグリシジルエーテ ルが、耐熱性、耐湿性などの面で優れており、 現在、最も多く用いられている。

発明が解決しょうとする問題点

しかしながら、近年、半導体素子の高密度化及び大型化が急速に進んできており、さらに高品質の樹脂材料が要求されている。 この封止用樹脂材料には、第一に、加水分解性塩素の少ないこと、次に高ガラス転移温度及び低弾性率であることが要求されている。特に、高ガラス転

多価フェノールノポラックのグリシジルエーテ ルにすることにより、かかる要求が満足される ことを見い出した。

すなわち、本発明は、一般式

(式中、Rは水素原子、炭素数 1 ~ 4 個のアルキル基及び芳香族基からなる群より選ばれた基であり、nは平均 1.5 以上 2 5 以下の数である。)

で表わされる多価フェノールノポラックのグリ シジルエーテルに関する。

本発明の多価フェノールノポラックのグリシ ジルエーチルは、式 移温度が要求されるのは、次の2つの理由による。第一には、半導体素子による発熱により、ではる発熱により、その内部温度は、160でにも速することが知られており、今後、半導体素子の高密度化及びいる。第二には、半導体集積回路の製作工程には、半導体集積回路の製作工程には、半導体集積回路の製作工程には、の動がかることである。将来は、製作工がの自動化、簡素化のために半導体素子をれた耐力を表することも考えられており、それに耐た得るだけの耐熱性を要求されている。

本発明の目的は、加水分解性塩素が少なく、かつ耐熱性に優れた硬化物を提供し得る多価フェノールノボラックのグリシジルエーテルを得ることである。

問題を解決するための手段

本発明者らは、前配の要求を満足する多価フェノールのグリシジルエーテルについて鋭意検討の結果、次に示すような特定の構造を有する

で表わされるピスフェノール(1,8,8ートリメチルー1,pーヒドロキシフェニルーインダンー6ーオール)を、一般式

(式中、Rは水素原子、炭素数1~4個のアルキル基及び芳香族基からなる群より選ばれた基である。)

で表わされるアルデヒド類と稲重合して多価フェノールノボラックとし、ついで該多価フェノールをエピハロヒドリンでもってグリシジルエーテル化することにより製造できる。

本発明の式(4)で表わされるピスフェノールは、例えば、米国特許第 3,288,864 号 明細書に配載の方法で製造できる。すなわち、式

で表わされるpーイソプロペニルフェノールを 有機溶剤中で、フリーデルクラフト触媒、例え は三弗化ほう素、塩化アルミニウムなどを加え て加熱することにより得られるが、この方法の みには限られない。

一般式回で扱わされるアルデヒド類の具体例 としては、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ ド、ペンズアルデヒドなどである。

式(I)において数平均繰り返し単位数 n は平均
1. 5 以上 2 5 以下であり、好ましくは 2 以上
1 5 以下である。該 n が 2 5 を越えると高分子量体となり、該 グリシジルエーテルは高温条件でも高粘度となり、取扱いが困難となる。また、
数 n が 2 より小さいと該 グリシジルエーテルは
常温で半固形もしくは粘調な液となって取扱いが困難となる。また、数平均分子彙は、約 500

なものであり、一般式

(式中、Rは水素原子、炭素数 1 ~ 4 個のアルキル基、芳香族基からなる群より選ばれた基であり、nは平均 1.5 以上 2 5 以下の数である。)

で丧わされる。

なお、本発明の新規な多価フェノールノポラックは、一般にエポキシ樹脂を主剤とする時の 硬化剤としても使用することができる。

このようにして得た多価フェノールノボラックをグリシジルエーテル化するには、一価または多価のフェノールからそのグリシジルエーテルを製造するのに通常用いられる方法が適用できる。例えば、多価フェノール類をエピハロヒドリンに溶解し、この溶液にアルカリ金属水酸

~10,000 の範囲である。数平均分子量は、蒸気圧浸透圧法により決定され、これより数平均繰り返し単位数が算出される。

本発明の、式仰で表わされるピスフェノール と一般式间で嵌わされるアルデヒド糖を結正合 し、多価フェノールノポラックとするには、通 常用いられるノポラック型フェノール樹脂の製 造方法が適用でき、回分式でも、特開阳 5 1 -180498号記載のように連続法でもよい。製 法の一例を示すと、エンサイクロペディア・オ ブ・ポリマーサイエンス・アンド・テクノロジ ー(インターサイエンス・パブリッシャーズ) 第10巻1頁のフェノリック・レジンズの項に 記載されるように、塩酸、リン酸、硫酸などの 無機酸又はパラトルエンスルホン酸、シュウ酸 などの有機酸又は酢酸亜鉛などの金属塩を触媒 としてフェノール類とアルデヒド類からの棺置 合により製造される。また、必要により、芳香 族系などの溶剤を使用してもよい。このように して得られる多価フェノールノポラックは新規

化物水溶液を連続的に添加しその間反応混合物から水及びエピハロヒドリンを蒸留し、蒸留した液を分液して水層は除去しエピハロヒドリンは反応系内に戻すという製造法を用いることができる。エピハロヒドリンの具体例としては、エピクロルヒドリン、エピブロムヒドリンなどがあるが、工業的な入手の容易性からエピクロルヒドリンが好ましい。

本発明の多価フェノールノポラックのグリシジルエーテルは、これに硬化剤、硬化促進剤、 無機質充填剤等を配合して各種の用途に用いられる。

硬化剤としては、フェノールノボラック、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスタン、無水フタルは、無水テトラヒドロフタル酸、無水ピロメリット酸、無水ペンゾフェノンテトラカルボン酸、無機質充填剤としてはシリカ、アルミナ、タルク、クレー、ガラス繊維などである。硬化促進剤としては、イミダゾール類、三級アミン

類、フェノール類などである。また必要に応じてステアリン酸、ステアリン酸カルシウム、カルナパワックス、モンタンワックスなどの内部 離型剤、トラブロムピスフェノールのグリシジ ルエーテルなどの難燃性付与剤を配合すること ができる。

硬化剤、充填剤、硬化促進剤および内部離型剤の配合量はそれぞれの種類によって変化するが、原則として硬化剤は多価フェノールノボラックのグリシジルエーテルのエポキシ基のモル数と同等な硬化剤の官能基のモル類になるような配合量、充填剤は全配合量の体積に対して充填剤がほぼ最密充填に近くなるような配合量、硬化促進剤は触媒量程度の配合量、内部離型剤は全配合量に対して約0.2~20萬量%がそれぞれ使用される。

本発明の多価フェノールノポラックのグリシジルエーテルは、従来よりあるオルソクレゾールノポラックのグリシジルエーテルまたはフェノールノポラックのグリシジルエーテルよりも

高ガラス転移温度の硬化物が得られ、また加水、 分解性塩素の含有量が小さい。

このため本発明の多価フェノールノボラック のグリシジルエーテルは、上記の各種の配合剤 を配合して特に半導体集積回路の封止剤として 好適に使用できる。

実 施 例

実施例 1

 第 1 図の ¹⁸CーNMR チャートのピークの帰 調は次のとおりである。

特開昭61-246219(5)

① 80.5 ppm, ② 40.0 ppm, ③ 59.9 ppm ④ 50.0 ppm, ⑥ 80.8 ppm, ⑤ 81.0 ppm 芳香環炭素:約111~157 ppm

(2) 多価フェノールノボラックのグリシジルエーテルの合成

エーテルを 1.0 モル (エポキン 基として、 具体的には 2 2 7 9) とフェノールノボラック 1.0 モル (フェノール性水酸 基 重 量 の の ト には 2 2 5 °) であった。

比較例 1

市販のクレゾールノボラックのグリシジルエーテル(住友化学工業株式会社製スミエボキシ® ESCN - 220)を主剤として、実施例1の(8)と開様な処弦で硬化成形物を作った。この成形物の粘弾性測定結果を第8図に示す。
ガラス転移温度は198℃であった。

比較例 2

1 1 7 0、エポキシ当量 2 2 7、加水分解性 塩素は 0.06 wt%であった。また、この樹脂 を重水素量換クロロホルムに溶かし、 ¹⁸Cー NMR を測定した。そのチャートを第 2 図に 示す。

第 2 図の ¹⁸C - NMRチャートのピークの帰 属は次のとおりである。

① 80.6 ppm, ② 42.2 ppm, ③ 59.7 ppm,

(50.1 ppm, (80.5 ppm, (80.8 ppm,

⑦ 68.8 ppm, ⑤ 50.0 ppm, ⑥ 44.5 ppm,

芳香環炭素:約108~158 ppm

(8) 硬化物の粘弾性測定

(2)で得られた多価フェノールのグリシジル

1,8,8ートリメチルー1,pーヒドロキシフェニルーインダンー6ーオール(純度92%)を原料として、実施例1の(2)の方法で多価フェノールのグリシジルエーテルを得た。この多価フェノールのグリシジルエーテルは、常温で半箇型であり、エポキシ当量は208、加水分解性塩素は0.09 wt % であった。

この多価フェノールのグリシジルエーテルを主剤として、実施例1の(8)と同様な処方で、硬化成形物を作った。この成形物の粘弾性脚定結果を第8図に示す。ガラス転移温度は168℃であった。

第8図を詳細に説明するならば、横軸は粘 弾性測定時の温度、縦軸の左側は動的弾性率、 縦軸の右側は tan かを示す。実線は実施例 1、 点線は比較例 1、一点鎖線は比較例 2 の硬化 成形物についての測定結果である。上側の実 線 1、点線 2、および一点鎖線 8 は、動的弾 性率を示し、本文中では単に弾性率と表現し た。また、下側の突線 1', 点線 2', および一点鎖線 8'は、 tan 8 を示す。

ー70℃付近での tan &のピークは副分散とよばれ分子のミクロブラウン運動に帰因する。160℃付近および200℃付近の tan &のピークは、主分散とよばれ分子全体の運動に帰因し、 tan &のピーク点での温度をガラス転移温度とする。

発明の効果

現在、半導体対止用には、主として、比較例 1に示したようなクレゾールノポラックのグリ シジルエーテルが用いられている。これに対し て、より低弾性率で、より高いガラス転移温度 を持つグリシジルエーテルが要求されている。

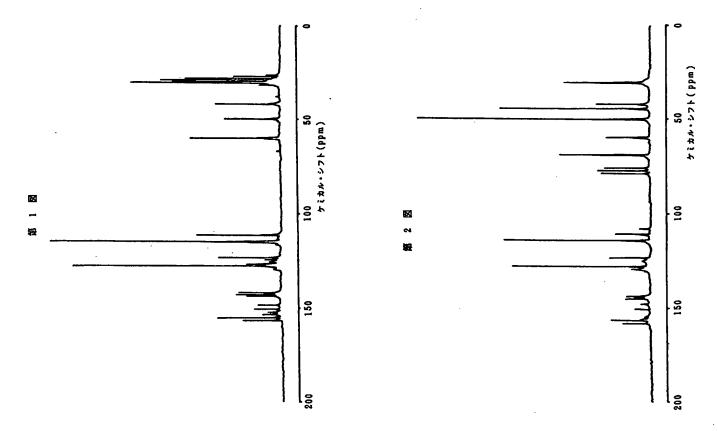
本発明の多価フェノールノボラックのグリシジルエーテルは、従来からのクレゾールノボラックのグリシジルエーテルや耐熱性のグリシジルエーテルに対して高いガラス転移温度を持ち、かつ弾性率及び加水分解性塩素含有量は同等であり、半導体封止用の組成物の主剤として優れ

た特性を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、実施例1の(1)で得られた多価フェノールノポラックの ¹⁸Cー NMR チャートである。
 第2図は、実施例1の(2)で得られた多価フェノールノポラックのグリシジルエーテルの ¹⁸CーNMR チャートである。

第8 図は、実施例 1 、比較例 1 および 2 の硬化成形物についての粘弾性測定結果(動的弾性率または tan & 一温皮関係図)である。第8 図において、1,2,8 はそれぞれ実施例 1 、比較例 1 、2 の硬化成形物の動的弾性率一温度関係を示す。また 1′, 2′, 8′はそれぞれ実施例 1 、比較例 1 、2 の硬化成形物の tan & 一温度関係を示す。



特開昭61-246219(7)

